

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Nome **Quilici Simona**

Italiana

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da – a) 01/09/15 → a oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo IC via Maniago, via Maniago 30 Milano
- Tipo di azienda o settore Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
  - Tipo di impiego Dirigente Scolastico
  
- Date (da – a) 30/06/14 → 31/08/15
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo IC Paderno Dugnano, via Manzoni, 31, Paderno Dugnano (MI)
- Tipo di azienda o settore Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
  - Tipo di impiego Dirigente Scolastico
  
- Date (da – a) 01/09/07 → 29/06/14
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo A. Stoppani, via Stoppani, 1, Milano
- Tipo di azienda o settore Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
  - Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato - cattedra A059 - Matematica e Scienze

- Principali mansioni e responsabilità
  - Date (da – a) 01/09/01 – 31/08/07
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi, p.zza Gasparri, 6, Milano
  - Tipo di azienda o settore Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
  - Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato - cattedra A059 - Matematica e Scienze
- Principali mansioni e responsabilità Funzione strumentale Area 2 "Supporto ai docenti per l'utilizzo delle nuove tecnologie" (a.s. 03/04)
  - Date (da – a) 02/07/01 – 30/08/01
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Ubiquity SpA., via Teodosio, 65, Milano
  - Tipo di azienda o settore Informatica
  - Tipo di impiego Consulente di prodotto
- Principali mansioni e responsabilità Supervisione e testing di software per palmari.
- Date (da – a) 16/12/00 – 01/07/01
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Enel.it SpA., viale Italia, 26, Sesto S. Giovanni (Mi)
  - Tipo di azienda o settore Settore elettrico
  - Tipo di impiego Analista programmatore
- Principali mansioni e responsabilità Sviluppo applicazioni e supporto ai responsabili di progetto nella redazione della documentazione tecnica e gestionale richiesta dal Sistema Qualità aziendale.
- Date (da – a) 26/11/99 – 11/12/00
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Sperimentale legalmente riconosciuto "R. Steiner", via Clericetti, 45, Milano
  - Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
  - Tipo di impiego Docente con incarico annuale - cattedra A049 - Matematica e Fisica
- Principali mansioni e responsabilità Tutor di classe.
- Date (da – a) 15/04/00 – 30/09/00
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Editrice Quadratum SpA, p.zza Aspromonte, 13, Milano
  - Tipo di azienda o settore Editoria
  - Tipo di impiego Collaboratore
- Principali mansioni e responsabilità Elaborazione di testi, e ricerca del materiale fotografico.
- Date (da – a) 7/01/00 – 14/01/00
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale "A. Volta", via B. Marcello, 7, Milano
  - Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
  - Tipo di impiego Supplenza temporanea - cattedra A049 - Matematica e Fisica
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a) 17/11/98 – 4/12/98
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale "A. Volta", via B. Marcello, 7, Milano



- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Livello nella classificazione nazionale

1991- 1997

Università degli Studi di Milano

Laurea in Fisica – Titolo della tesi: “Studio della conducibilità ionica ad alta temperatura tramite spettroscopia di impedenza: applicazioni a SiO<sub>2</sub>:Ge e ossidi termici” – votazione **109/110**

Chimica / fisica dello stato solido, spettroscopia

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

**Italiano**

ALTRE LINGUE

*Livello europeo secondo il Quadro comune europeo di riferimento per lingue*

• Comprensione

**Inglese**

• Parlato

ASCOLTO: B2 (utente autonomo) – LETTURA: C1 (utente avanzato)

• Scritto

INTERAZIONE ORALE: B2 (utente autonomo) – PRODUZIONE ORALE: B2 (utente autonomo)  
B2 (utente autonomo)

• Comprensione

**Tedesco**

• Parlato

ASCOLTO: A1 (utente base) – LETTURA: B1 (utente autonomo)

• Scritto

INTERAZIONE ORALE: A1 (utente base) – PRODUZIONE ORALE: A1 (utente base)

A2 (utente base)

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era necessaria la collaborazione e la coordinazione tra colleghi (attività di ricerca, consulenza, progettazione didattica)

Capacità di individuare dinamiche di relazione disfunzionali e di gestire situazioni potenzialmente conflittuali, maturata in ambito universitario e scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE.

Capacità di coordinare e organizzare le attività del gruppo, maturata in ambito lavorativo

Capacità di individuare le risorse e motivare il personale

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

Uso abituale del computer, di Internet, della posta elettronica, dei programmi Word, Excel e PowerPoint.

Uso a fini lavorativi della piattaforma di segreteria digitale e protocollo web.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Competenze artistico espressive che spaziano dalla cucina al ballo, alle attività di ricamo e composizione artistica.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Idoneità a ricoprire la carica di Dirigente Scolastico, conseguita a seguito del superamento di pubblico concorso (DDG 13/07/11).

Abilitazione all'Insegnamento per la classe di concorso A038 – Fisica, conseguita il 6/12/00 con punti 58/80.

Abilitazione all'Insegnamento per la classe di concorso A059 – Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali per la Scuola Media, conseguita il 19/2/01 con punti 75.9/100.

## PUBBLICAZIONI

D. Del Frate, S. Quilici, G. Spinolo and A. Vedda, *High temperature a.c. conductivity of amorphous SiO<sub>2</sub> fused silica and thin thermal films*, Phys. Rev. B 59, 9741 (1999).

D. Del Frate, S. Quilici, G. Spinolo and A. Vedda, *Ionic transport in fused silica and thin thermal SiO<sub>2</sub> films*, Radiation Effects and Defects in Solids 151,47 (1999).

F. Meinardi, S. Quilici, L. Moro, G. Queirolo and A. Sabbadini, *Doping influence on TiSi<sub>2</sub> C49-C54 phase conversion kinetics by micro-Raman spectroscopy*, Advanced Interconnects and Contact Materials and Process for Future Integrated Circuits, Symposium Mater. Res. Soc. 1998, pp. 387-92, Warrendale, PA.

S. Quilici, F. Meinardi and A. Sabbadini, *Micro-Raman analysis of post-silicidation thermal treatments on C54 TiSi<sub>2</sub> formation in confined areas*, Solid State Comm. 109, 141 (1999).

S. Privitera, M. G. Grimaldi, E. Rimini, S. Quilici and F. Meinardi, *Determination of the C54 nucleation site density in narrow strips by sheet resistance measurements and  $\mu$ -Raman spectroscopy*, Microelectronics Engineering Special Issue, in press.

F. Meinardi, S. Quilici, A. Borghesi and G. Artioli, *Microstructure of polycrystalline C54-TiSi<sub>2</sub> thin films by micro-Raman spectroscopy*, Appl. Phys. Lett. 75, 3090 (1999).

S. Privitera, F. La Via, C. Spinella, S. Quilici, A. Borghesi, F. Meinardi, M. G. Grimaldi, and E. Rimini, *Nucleation and growth of C54 grains into C49 TiSi<sub>2</sub> thin films monitored by micro-Raman imaging*, Phys. Rev. B, in press.

S. Quilici, *Micro-Raman spectroscopy applied to microelectronics: the phase transition of TiSi<sub>2</sub> from C49 to C54*, in Silicides: Fundamentals and Applications, The Science and Culture Series - Materials Science, Series Editor: A. Zichichi, ed. L. Miglio, F. d'Heurle, World Scientific, Geneva, Switzerland.

La Cucina Italiana, *Dolci – 140 ricette per 4 stagioni*, numero speciale 6/00, ed Quadratum.

La Cucina Italiana, *Formaggi – 130 ricette a tutto sapore*, numero speciale 11/00, ed Quadratum.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA  
RISULTANTE DAL CONTRATTO  
INDIVIDUALE

Stipendio tabellare	Posizione parte fissa	Posizione parte variabile	Retribuzione di risultato	Altro*	TOTALE ANNUO LORDO
43.310,90 €	3.556,68 €	6.897,28 €	0,00 €	0,00 €	53.764,86 €

\*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196.